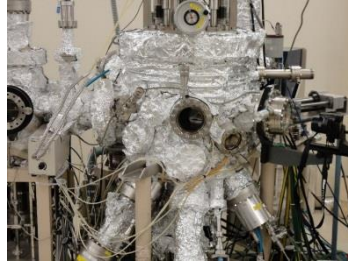


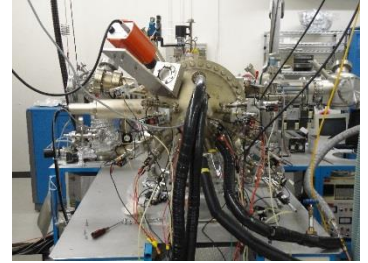
ナノ電子デバイス学研究室実験設備

成膜装置

- マグネトロンスパッタ装置(2台)(ULVAC)
高品質な強磁性薄膜の成長が可能
電子ビーム蒸着源を装備
マルチチャンバー構成
- 分子線エピタキシー(MBE)装置(RIBER)
Ⅲ-V属化合物半導体の成長が可能
強磁性金属成長用のチャンバーを増設



スパッタ装置



MBE装置

デバイス加工装置

- フォトリソグラフィ装置(ミカサ)
- Arイオンミリング装置
- 蒸着装置(2台)
抵抗加熱・電子ビーム方式を兼備
- 磁場中アニール装置
- 酸化炉
- ダイシング装置
- 酸素プラズマアッシャー
- 触針式段差測定計



フォトリソグラフィ



イオンミリング装置

デバイス特性評価装置

- 低温クライオスタット(3台)
超伝導マグネット搭載(2台)
光学測定用窓装備(1台)
- ウェハープローバー
- 磁場中電気伝導特性評価システム



クライオスタット



X線回折装置

共同利用設備

- X線回折装置
2次元検出器、4結晶モノクロメーター装備
- 走査型電子顕微鏡
- 電子線リソグラフィ装置
- 反応性イオンエッチング装置